

表1. 常設分科 Regular categories				
大分類分科名 Category	中分類分科名		Section	委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
1 応用物理学一般 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology	1.1	応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and General Physics	面谷信 (東海大)
	1.2	教育	Education	吉田雅昭 (八戸高専)
	1.3	新技術・複合新領域	Novel technologies and interdisciplinary engineering	松谷晃宏 (東工大)
	1.4	エネルギー・変換・貯蔵・資源・環境	Energy conversion, storage, resources and environment	小栗和也 (東海大)
	1.5	計測技術・計測標準	Instrumentation, measurement and Metrology	寺崎正 (産総研)
	1.6	超音波	Ultrasonics	近藤淳 (静岡大)
2 放射線 Ionizing Radiation	2.1	放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and Detector fundamentals	伏見賢一 (徳島大), 越水正典 (東北大), 人見啓太郎 (東北大)
	2.2	検出器開発	Detection systems	
	2.3	放射線応用・発生装置・新技術	Application, radiation generators, new technology	
		光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics	居波渉 (静岡大)
3 光・フotonics Optics and Photonics	3.2	材料・機器光学	Equipment optics and materials	石飛秀和 (阪大), 尾下善紀 (ニコン), 片山龍一 (福岡工大)
	3.3	情報フotonics・画像工学	Information photonics and image engineering	片山龍一 (福岡工大), 成瀬誠 (情通機構), 山本裕紹 (宇都宮大), 小倉裕介 (阪大)
	3.4	生体・医用光学	Biomedical optics	西館泉 (農工大)
	3.5	レーザー装置・材料	Laser system and materials	興雄司 (九大), 時田茂樹 (阪大), 宮本克彦 (千葉大)
	3.6	超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	石澤淳 (NTT), 高橋栄治 (理研)
	3.7	レーザープロセッシング	Laser processing	細川陽一郎 (奈良先端大), 佐藤正健 (産総研)
	3.8	光計測技術・機器	Optical measurement, instrumentation, and sensor	平井亜紀子 (産総研), 塩田達俊 (埼玉大), 柴田泰邦 (首都大)
	3.9	テラヘルツ全般	Terahertz technologies	松原英一 (大阪歯科大), 山下将嗣 (理研)
	3.10	光子量子物理・技術	Optical quantum physics and technologies	行方直人 (日大)
	3.11	フォトニック構造・現象	Photonic structures and phenomena	新家昭彦 (NTT), 浅野卓 (京大)
	3.12	ナノ領域光学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics	酒井優 (山梨大), 若見健太郎 (農工大)
	3.13	半導体光デバイス	Semiconductor optical devices	下村和彦 (上智大), 中村滋 (NEC), 荒川太郎 (横国大)
	3.14	光制御デバイス・光ファイバー	Optical control devices and optical fibers	石月秀貴 (NINS), 渡邊俊夫 (鹿児島大), 和田篤 (防衛)
	3.15	シリコンフotonics	Silicon photonics	庄司雄哉 (東工大), 岡野誠 (産総研)
	3.16	Optics and Photonics English Session	Optics and Photonics English Session	興雄司 (九大), 下村和彦 (上智大)
6 薄膜・表面 Thin Films and Surfaces	6.1	強誘電体薄膜	Ferroelectric thin films	坂本渉 (名大), 小林健 (産総研)
	6.2	カーボン系薄膜	Carbon-based thin films	平栗健二 (東京電機大), 小倉政彦 (産総研)
	6.3	酸化物エレクトロニクス	Oxide electronics	廣瀬誠 (東大), 神吉輝夫 (阪大)
	6.4	薄膜新材料	Thin films and New materials	中村吉伸 (東大), 土屋哲男 (産総研)
	6.5	表面物理・真空	Surface Physics, Vacuum	高見知秀 (工学院大), 山田洋一 (筑波大)
	6.6	プローブ顕微鏡	Probe Microscopy	一井崇 (京大), 山田豊和 (千葉大)
		X線技術	X-ray technologies	砂原淳 (レーザー総研)
7 ビーム応用 Beam Technology and Nanofabrication	7.2	電子ビーム応用	Applications and technologies of electron beams	川崎忠寛 (JFCC), 根尾陽一郎 (静岡大)
	7.3	微細パターン・微細構造形成技術	Micro/Nano patterning and fabrication	山崎謙治 (岡山大), 山本治朗 (日立), 横尾篤 (NTT)
	7.4	量子ビーム界面構造計測	Buried interface sciences with quantum beam	桜井健次 (NIMS)
	7.5	イオンビーム一般	Ion beams	龍頭啓充 (京大)
		Atomic/molecular beams and beam-related new technologies		
	7.6	原子・分子線およびビーム関連新技術		田川雅人 (神戸大), 高岡毅 (東北大)
		Plasma Electronics English Session	Plasma Electronics English Session	金子俊郎 (東北大)
8 プラズマエレクトロニクス Plasma Electronics	8.1	プラズマ生成・制御	Plasma production and control	柳生義人 (佐世保高専)
	8.2	プラズマ診断・計測	Plasma measurements and diagnostics	伊藤剛仁 (阪大)
	8.3	プラズマ成膜・表面処理	deposition of thin film and surface treatment	太田貴之 (名城大)
	8.4	プラズマエッチング	Plasma etching	前田賢治 (日立)
	8.5	プラズマナノテクノロジー	nanotechnology.	酒井道 (滋賀県立大), 金子俊郎 (東北大)
	8.6	プラズマライフサイエンス	Plasma life sciences	山田英明 (産総研)
	8.7	プラズマ現象・新応用・融合分野	Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications	小田昭紀 (千葉工大)
		Dielectrics, ferroelectrics		和田智志 (山梨大)
9 応用物性 Applied Materials Science	9.2	ナノワイヤ・ナノ粒子	Nanowires and Nanoparticles	原真二郎 (北大), 深田直樹 (物材機構)
	9.3	ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics	島田宏 (電通大)
	9.4	熱電変換	Thermoelectric conversion	中津川博 (横国大), 林慶 (東北大)
	9.5	新機能材料・新物性	New functional materials and new phenomena	高瀬浩一 (日大)
		Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)		近藤剛 (東芝)
	10.2	スピントルク・スピン流・回路・測定技術	Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies	野崎隆行 (産総研)
10 スピントロニクス・マグネティクス Spintronics and Magnetism	10.3	GMR・TMR・磁気記録技術	Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies	三輪真嗣 (阪大)
	10.4	半導体・有機・光・量子スピントロニクス	Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics	好田誠 (東北大)
	10.5	磁場応用	Application of magnetic field	山本勲 (横国大)
	11.1	基礎物性	Fundamental properties	堀井滋 (京大), 入江晃亘 (宇都宮大)
	11.2	薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth	一野祐亮 (名大)
11 超伝導 Superconductivity	11.3	臨界電流, 超伝導パワー応用	Critical Current, Superconducting Power Applications	小田部荘司 (九工大)
	11.4	アナログ応用および関連技術	Analog applications and their related technologies	山下太郎 (情通機構)
	11.5	接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction and circuit fabrication process, digital applications	山梨裕希 (横国大)

表1. 常設分科 Regular categories			
大分類分科名 Category	中分類分科名		委員(所属)
12 有機分子・バイオエレクトロニクス Organic Molecules and Bioelectronics	12.1	作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls
	12.2	評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics
	12.3	機能材料・萌芽のデバイス	Functional Materials and Novel Devices
	12.4	有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors
	12.5	有機太陽電池	Organic solar cells
	12.6	ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology
	12.7	医用工学・バイオチップ	Biomedical Engineering and Biochips
13 半導体 Semiconductors	13.1	Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
	13.2	探索的材料物性・基礎物性	Exploratory Materials, Physical Properties, Devices
	13.3	絶縁膜技術	Insulator technology
	13.4	Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	Si wafer processing /Si based thin film /MEMS/Integration technology
	13.5	デバイス／集積化技術	Semiconductor devices and related technologies
	13.6	Semiconductor English Session	Semiconductor English Session
	13.7	ナノ構造・量子現象	Nano structures and quantum phenomena
	13.8	化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	Compound and power electron devices and process technology
	13.9	光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices
	13.10	化合物太陽電池	Compound solar cells
15 結晶工学 Crystal Engineering	15.1	バルク結晶成長	Bulk crystal growth
	15.2	II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI and related compounds
	15.3	III-V族エピタキシャル結晶	III-V-group epitaxial crystals
	15.4	III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals
	15.5	IV族結晶, IV-IV族混晶	Group IV crystals and alloys
	15.6	IV族系化合物 (SiC)	Group IV Compound Semiconductors (SiC)
	15.7	エピタキシーの基礎	Fundamentals of epitaxy
	15.8	結晶評価, 不純物・結晶欠陥	Crystal evaluation, impurities and crystal defects
16 非晶質・微結晶 Amorphous and Microcrystalline Materials	16.1	基礎物性・評価・プロセス・デバイス	Fundamental properties, evaluation, process and devices in disordered materials
	16.2	エナジーハーベスティング	Energy Harvesting
	16.3	シリコン系太陽電池	Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
17 ナノカーボン Nanocarbon Technology	17.1	カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	Carbon nanotubes & other nanocarbon materials
	17.2	グラフェン	Graphene
	17.3	層状物質	Layered materials

表2. 合同セッション Joint sessions			
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"	薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。	This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.	廣瀬靖(東大),神吉輝夫 (阪大),中村吉伸 (東大),土屋哲男 (産総研),阿部友紀 (鳥取大),田橋正浩 (中部大),川原村敏幸(高知工科大)